

Sputtering 전 공정의
필수 Metal Coating

Stealth™

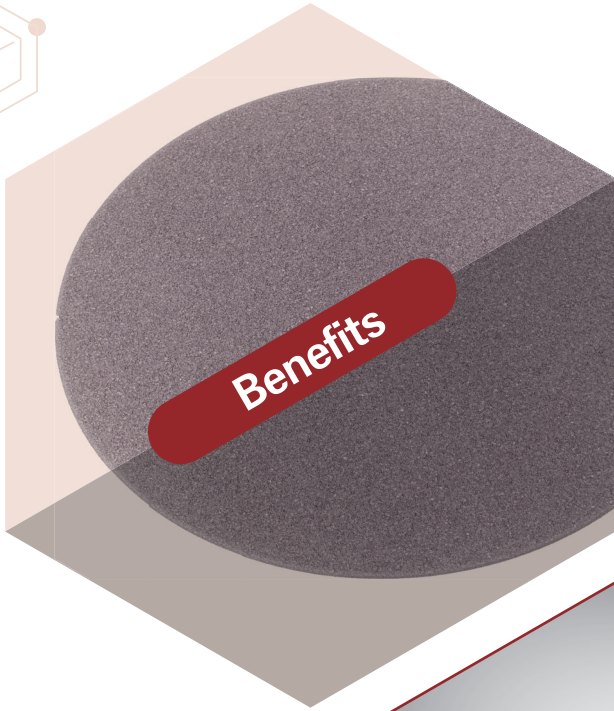
특허 출원 제10-2019-0088245호/제10-2020-0021111호



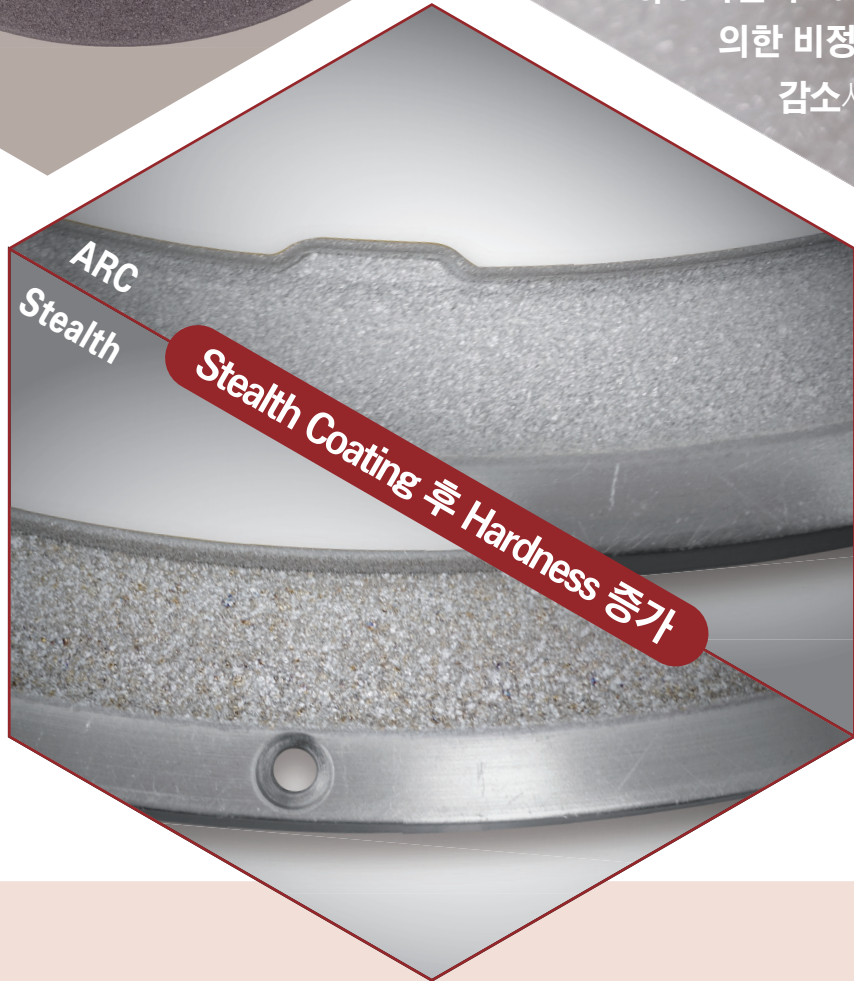
PVD 공정 중 챔버의 내벽으로 분산되는 스퍼터링 입자(박막물질)의 증착력을 높여 비정상적으로 박리되는 것을 억제 가능한

Stealth-1

COATING



기존의 ARC Coating 방식으로 A+ α (첨가제) Wire를 사용하여 Coating의 **Hardness**를 **16배 이상 증가시켜 높은 경도로 인한 Depo 막질의 Hard Deposition에 의한 비정상 박리 현상을 감소**시킬 수 있습니다.



CINOS Metal Coating Trend

Metal Coating은 반도체 집적화에 따라 Coating 기술 개발이 진행 되었으며, Al+ α (첨가제) Wire, Powder Coating 기술 개발 및 반도체 집적화 정도에 따라 **고객 Needs에 맞는 Coating을 제공** 가능합니다. Al ARC Coating은 반도체 설비 사용 시간연장을 위해 1200, 1400, 4000 μ inch 수준의 높은 Coating의 Roughness를 형성하는 기술을 보유하고 있습니다.

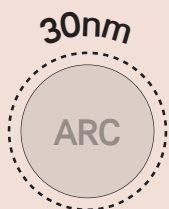
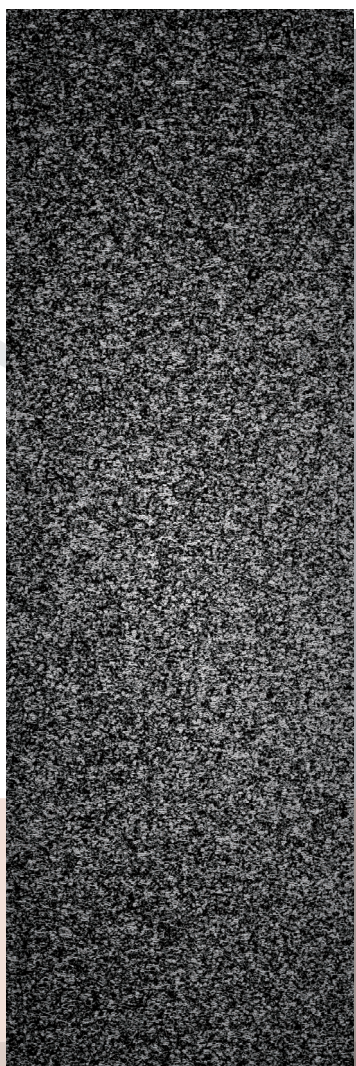
표면 구조를 갖도록 형성하는 것이 매우 중요하며, 이를 통해 Sputtering 시 기판의 일면에 증착되어 형성되는 박막 측 오염 및 불량을 방지할 수 있습니다.

Stealth-2

COATING



Stealth-2 Coating은 A+ α (첨가제) Powder를 사용하여 Stealth과 유사한 경도 특성을 보이며 Coating의 기공을 큰 폭으로 감소시켜 공정 사용시 Outgassing, Back-up Time 을 감소시킬 수 있습니다.



Al Wire



Al+ α Wire



Al+ α Powder

Advanced Hardness & Porosity Property

Performance
Technology
Quality

CINOS



Copyright by **CINOS Co.,Ltd.** All Rights Reserved.